要　約　書

本発明によるウエハ処理装置は、真空容器内部に配置され内側に処理用ガスが供給される処理室１０４と、処理室内に配置され処理対象のウエハを支持する円筒形を有した試料台２０１と、試料台の上部のウエハ２０４が載せられる載置面をリング状に囲んだ段差部と、段差部の底面上に載せられて載置面を囲むリング形状を有したガス分散板２０８と、ガス分散板の上面に載せられて載置面を囲むサセプタリング２０５と、ガス分散板の底面と段差部の底面との間の隙間と、ガス分散板の内周側壁と段差部の外周側壁との間の隙間と、サセプタリングの内周側壁と段差部の外周側壁との間の隙間とにより構成された不活性ガスが流れる流路とを有し、サセプタリングの内周側壁の複数の箇所に上下方向に延在する凹部４０１を備えたことを特徴とする。